# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2000年 6月23日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-189652

出 願 人 Applicant(s):

株式会社村田製作所

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOGUMENT





2001年 4月20日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 及川科



出証番号 出証特2001-30321

【書類名】

特許願

【整理番号】

37

【提出日】

平成12年 6月23日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G01P 15/12

【発明者】

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

田村 昌弥

【特許出願人】

【識別番号】

000006231

【氏名又は名称】

株式会社村田製作所

【代理人】

【識別番号】

100093894

【弁理士】

【氏名又は名称】

五十嵐 清

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

000480

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9004888

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 複合センサ素子およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 角速度センサと加速度センサが一体化されて成る複合センサ 素子であって、角速度に起因したコリオリカにより振動変位する角速度センサ用 の振動体と、加速度印加によって可動変位する加速度センサ用の可動体とが、基 台上に配設された同一の変位部形成部材によって、互いに間隔を介して変位可能 な状態に形成され、上記変位部形成部材の上方側には上記角速度センサ用の振動 体と加速度センサ用の可動体を間隔を介して覆う蓋部材が設けられており、上記 基台と変位部形成部材と蓋部材によって、上記角速度センサ用の振動体と加速度 センサ用の可動体を振動可能な状態で収容封止する空間部が形成されており、こ の空間部は上記角速度センサ用の振動体を収容封止する角速度センサ用空間部と 、該角速度センサ用空間部とは連通していない上記加速度センサ用の可動体を収 容封止する加速度センサ用空間部とに区分され、上記角速度センサ用空間部は上 記角速度センサ用の振動体がkHzオーダー以上の高周波数、かつ、設定以上の大 きな振幅でもって振動可能な真空状態に封止され、また、上記加速度センサ用空 間部は上記加速度センサ用の可動体が100Hz以下の低周波数で振動可能で、か つ、上記角速度センサ用の振動体の振動が上記加速度センサ用の可動体に伝搬し ても該加速度センサ用の可動体がkHzオーダー以上の高周波数、かつ、設定以上 の大きな振幅でもって振動することを防止する高周波振動抑制用の気圧状態に封 止されるか、あるいは、高周波振動抑制用のダンピング剤が充填されている状態 で封止されていることを特徴とした複合センサ素子。

【請求項2】 基台は、支持層と酸化層と活性層が積層形成されて成るSOI基板の上記支持層と酸化層により形成され、変位部形成部材は上記SOI基板の活性層により形成されていることを特徴とする請求項1記載の複合センサ素子

【請求項3】 角速度センサと加速度センサにはそれぞれ設定の定電位に維持される定電位部位を有し、それら角速度センサの定電位部位と加速度センサの定電位部位と加速度センサの定電位部位と加速度セ

ンサの定電位部位を外部の回路に接続するための共通の接続用電極部が設けられていることを特徴とした請求項1又は請求項2記載の複合センサ素子。

《請求項4》 請求項1又は請求項2又は請求項3記載の複合センサ素子の 製造方法であって、変位部形成部材に角速度センサ用の振動体と加速度センサ用 の可動体を同時に形成する工程と;この工程の後に、真空空間内で、上記角速度 センサ用の振動体と加速度センサ用の可動体の上側に蓋部材を配置し、該蓋部材 と、基台上に配設された上記変位部形成部材とを接合させて角速度センサ用の振 動体を角速度センサ用空間部に、加速度センサ用の可動体を加速度センサ用空間 部にそれぞれ収容すると共に、上記角速度センサ用空間部を上記角速度センサ用 の振動体がkHzオーダー以上の高周波数、かつ、設定以上の大きな振幅でもって 振動可能な真空状態で気密封止する工程と;上記加速度センサ用空間部と外部を 連通する供給用通路を形成する工程と;上記変位部形成部材の上側に蓋部材が接 合された接合体を高周波振動抑制用の気圧状態の空間内に配置して上記加速度セ ンサ用空間部を上記供給用通路を介し上記高周波振動抑制用の気圧状態にした後 に、あるいは、上記加速度センサ用空間部に上記供給用通路を介して高周波振動 抑制用のダンピング剤を充填した後に、上記供給用通路を塞いで上記加速度セン サ用空間部を気密封止する工程と;を含むことを特徴とした複合センサ素子の製 造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、角速度センサおよび加速度センサを有する複合センサ素子およびその製造方法に関するものである。

[0002]

# 【従来の技術】

角速度センサと加速度センサが対を成して使用される場合があり、このような場合を考慮して、角速度センサと加速度センサを一体化した複合センサ素子が提案されている。例えば、特開平10-10148号公報や特開平10-239347号公報には上記複合センサ素子の一例がそれぞれ示されている。これら公開

特許公報に示されている複合センサ素子は、角速度センサと加速度センサが同一 基板上に設けられているために、安価に作製することができ、また、小型化が容 易であるという効果を得ることができるものである。

[0003]

## 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記提案の複合センサ素子では、加速度検出の感度が好ましく ないという問題が生じる。それというのは、次に示すような理由に因る。

[0004]

振動型角速度センサは振動体を有し、この振動体がある一定の周波数で駆動振動しているときに角速度が加わるとコリオリカが発生し、このコリオリカによって上記振動体が変位する。このコリオリカによる変位量を検知することで角速度を検出する。上記駆動振動の速度が速いほど上記コリオリカの大きさが大きくなるので、角速度センサの検出感度を良好にするためには、角速度センサの振動体を数kHzという高周波数、かつ、例えば数μmというような大きな振幅でもって振動させる必要がある。

[0005]

しかしながら、マイクロマシニング技術で作製した微細な振動体は、空気のダンピングの影響を大きく受ける。そのダンピングは振動体の速度に比例して発生する力なので、大気中では、速度の速い状態、つまり、上記のような高周波数、かつ、大きな振幅を持った状態で上記振動体を振動させようとすると、上記ダンピングの影響が非常に大きくなり、そのような高周波数、かつ、大きな振幅を持った状態で上記振動体を振動させることができない。その結果、角速度センサの検出感度を著しく悪化させてしまう。

[0006]

そこで、上記角速度センサの振動体と、加速度センサを構成している可動体と の上方側を間隔を介して覆う蓋部材を上記角速度センサと加速度センサが設けられている基板に取り付け、上記蓋部材と基板から成る同一空間内に上記角速度センサの振動体と加速度センサの可動体を共に収容させ、その空間内を上記角速度センサの振動体が高周波数で、かつ、角速度検知に十分な設定以上の振幅でもっ て振動可能な真空状態(減圧状態)で気密封止することが考えられる。これにより、上記角速度センサの振動体は所望の高周波数、かつ、角速度検知に十分な大きな振幅を持った状態で振動することができることとなる。

# [0007]

しかしながら、上記の如く加速度センサの可動体も上記角速度センサの振動体と同じ真空空間内に配置してしまうと、非常に振動し易い状態となってしまう。 上記角速度センサの振動体の振動が上記基板を介して加速度センサの可動体に伝搬されると、加速度センサの可動体も上記角速度センサの振動体と同様の高周波数、かつ、大きな振幅を持った状態で振動してしまう。加速度センサの可動体は加速度が印加していない時には静止状態であることが望まれるが、上記の如く、角速度センサの振動体の伝搬振動に起因して加速度センサの可動体が高周波数、かつ、大きな振幅を持った状態で振動してしまうと、その高周波振動がノイズとなり、加速度を感度良く検出することができないという問題が生じる。

# [0008]

さらに、上記加速度センサの可動体が上記のように真空空間内に配置されている場合に、加速度センサの可動体の共振周波数成分を持った加速度が印加されると、加速度の大きさに関係なく、上記可動体が共振状態になって振幅が増大してしまうために、加速度を正確に検出できないという問題も発生する。

# [0009]

本発明は上記課題を解決するために成されたものであり、その目的は、角速度 センサと加速度センサの両方の検出感度を共に向上させることができる複合セン サ素子およびその製造方法を提供することにある。

#### [0010]

#### 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、この発明は次に示す構成をもって前記課題を解決する手段としている。すなわち、第1の発明の複合センサ素子は、角速度センサと加速度センサが一体化されて成る複合センサ素子であって、角速度に起因したコリオリカにより振動変位する角速度センサ用の振動体と、加速度印加によって可動変位する加速度センサ用の可動体とが、基台上に配設された同一の変位部形

4

成部材によって、互いに間隔を介して変位可能な状態に形成され、上記変位部形 成部材の上方側には上記角速度センサ用の振動体と加速度センサ用の可動体を間 隔を介して覆う蓋部材が設けられており、上記基台と変位部形成部材と蓋部材に よって、上記角速度センサ用の振動体と加速度センサ用の可動体を振動可能な状 熊で収容封止する空間部が形成されており、この空間部は上記角速度センサ用の 振動体を収容封止する角速度センサ用空間部と、該角速度センサ用空間部とは連 通していない上記加速度センサ用の可動体を収容封止する加速度センサ用空間部 とに区分され、上記角速度センサ用空間部は上記角速度センサ用の振動体がkHz オーダー以上の髙周波数、かつ、設定以上の大きな振幅でもって振動可能な真空 状態に封止され、また、上記加速度センサ用空間部は上記加速度センサ用の可動 体が100Hz以下の低周波数で振動可能で、かつ、上記角速度センサ用の振動体 の振動が上記加速度センサ用の可動体に伝搬しても該加速度センサ用の可動体が kHzオーダー以上の高周波数、かつ、設定以上の大きな振幅でもって振動するこ とを防止する高周波振動抑制用の気圧状態に封止されるか、あるいは、高周波振 動抑制用のダンピング剤が充填されている状態で封止されている構成をもって前 記課題を解決する手段としている。

#### [0011]

第2の発明の複合センサ素子は、上記第1の発明の構成を備え、基台は、支持層と酸化層と活性層が積層形成されて成るSOI基板の上記支持層と酸化層により形成され、変位部形成部材は上記SOI基板の活性層により形成されていることを特徴として構成されている。

#### [0012]

第3の発明の複合センサ素子は、上記第1又は第2の発明の構成を備え、角速度センサと加速度センサにはそれぞれ設定の定電位に維持される定電位部位を有し、それら角速度センサの定電位部位と加速度センサの定電位部位は導通接続されており、それら角速度センサの定電位部位と加速度センサの定電位部位を外部の回路に接続するための共通の接続用電極部が設けられていることを特徴として構成されている。

5

[0013]

第4の発明の複合センサ素子の製造方法は、上記第1又は第2又は第3の発明 を構成する複合センサ素子の製造方法であって、変位部形成部材に角速度センサ 用の振動体と加速度センサ用の可動体を同時に形成する工程と;この工程の後に 、真空空間内で、上記角速度センサ用の振動体と加速度センサ用の可動体の上側 に蓋部材を配置し、該蓋部材と、基台上に配設された上記変位部形成部材とを接 合させて角速度センサ用の振動体を角速度センサ用空間部に、加速度センサ用の 可動体を加速度センサ用空間部にそれぞれ収容すると共に、上記角速度センサ用 空間部を上記角速度センサ用の振動体がkΗΖオーダー以上の高周波数、かつ、設 定以上の大きな振幅でもって振動可能な真空状態で気密封止する工程と;上記加 速度センサ用空間部と外部を連通する供給用通路を形成する工程と;上記変位部 形成部材の上側に蓋部材が接合された接合体を高周波振動抑制用の気圧状態の空 間内に配置して上記加速度センサ用空間部を上記供給用通路を介し上記高周波振 動抑制用の気圧状態にした後に、あるいは、上記加速度センサ用空間部に上記供 給用通路を介して高周波振動抑制用のダンピング剤を充填した後に、上記供給用 通路を塞いで上記加速度センサ用空間部を気密封止する工程と;を含むことを特 徴として構成されている。

# [0014]

上記構成の発明において、角速度センサ用の振動体と加速度センサ用の可動体は同一の変位部形成部材に離間形成されているが、上記角速度センサ用の振動体と加速度センサ用の可動体はそれぞれ異なる空間部に収容封止されている。つまり、上記角速度センサ用の振動体は角速度センサ用空間部(つまり、角速度センサ用の振動体がkHzオーダー以上の高周波数、かつ、角速度検知に必要な大きな振幅でもって振動可能な真空状態の空間部)に収容封止されている。また、加速度センサ用の可動体は加速度センサ用空間部(例えば高周波振動抑制用の大気圧の雰囲気状態で封止されるか、あるいは、高周波振動抑制用のダンピング剤が充填されている状態の空間部)に収容封止されている。

#### [0015]

角速度センサ用の振動体は上記のような真空雰囲気中に配置されているので、 角速度検知に十分な高周波数、かつ、大きな振幅でもって振動することができ、 角速度を感度良く検出することができる。また、加速度センサ用の可動体は、該可動体が高周波数、かつ、大きな振幅でもって振動することができない大気圧の雰囲気中、あるいは、上記ダンピング剤の中に配置されているので、例えば、角速度センサ用の振動体の振動が変位部形成部材を通して加速度センサ側に伝搬されても、上記大気圧の雰囲気あるいはダンピング剤によって、加速度センサ用の可動体が高周波数、かつ、大きな振幅でもって振動することを防止することができる。これにより、高周波振動に起因した加速度センサの感度悪化を回避することができ、加速度検出の感度を向上させることができる。

[0016]

このように、角速度センサと加速度センサの各検出感度を両方共に向上させる ことが可能な複合センサ素子を提供することが可能となる。

[0017]

【発明の実施の形態】

以下に、この発明に係る実施形態例を図面に基づいて説明する。

[0018]

図1にはこの発明の複合センサ素子の一実施形態例が平面図により模式的に示され、図2(a)には図1に示すA-A部分の断面図が模式的に示され、また、図2(b)には図1に示すB-B部分の断面図が模式的に示されている。

[0019]

これら図1および図2(a)、(b)に示す複合センサ素子1は角速度センサ2と加速度センサ3が一体的に形成されたものであり、基台であるガラス基板4と、蓋部材であるガラス基板30と、変位部形成部材であるシリコン基板45とを加工して作製されるものである。

[0020]

この実施形態例に示す角速度センサ2は角速度センサ用の振動体である平面振動体5を有し、この平面振動体5は上記シリコン基板45により加工形成されている。ガラス基板4には、図2(a)に示すように、上記平面振動体5に対向する領域に凹部4aが形成されており、この凹部4aによって、上記平面振動体5は浮いた状態と成し、変位可能となっている。



(\*)

上記平面振動体 5 は、図1に示すように、駆動梁 6 (6 a, 6 b, 6 c, 6 d) と、外枠 7 と、櫛歯形状の駆動用可動電極部 8 (8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 8 g, 8 h) と、支持部 9 (9 a, 9 b) と、連結梁 1 0 (1 0 a, 1 0 b, 1 0 c, 1 0 d) と、内枠 1 1 と、櫛歯形状の検出用可動電極部 1 2 (1 2 a, 1 2 b, 1 2 c, 1 2 d) とを有して構成されており、この平面振動体 5 は、ガラス基板 4 に固定形成されている固定部 1 3 (1 3 a, 1 3 b) に支持 固定されている。

#### [0022]

図1に示すように、上記平面振動体5の駆動梁6a,6bの各一端側は共通に上記固定部13aに接続され、また、駆動梁6c,6dの各一端側は共通に上記固定部13bに接続されており、上記駆動梁6a,6b,6c,6dの各他端側は共通に外枠7に接続されている。この外枠7の図1の左右両端縁部には上記櫛歯形状の駆動用可動電極部8(8a,8b,8c,8d,8e,8f,8g,8h)が形成されている。

# [0023]

上記外枠7の図1の左右両側を間隔を介して挟み込む形態で固定部14(14a,14b,14c,14d)がガラス基板4に固定形成されており、これら各固定部14にはそれぞれ上記駆動用可動電極部8に間隔を介して噛み合う櫛歯形状の駆動用固定電極部15(15a,15b,15c,15d,15e,15f,15g,15h)が設けられている。

#### [0024]

また、上記外枠7から連結梁10(10a,10b,10c,10d)が伸長 形成され、上記連結梁10a,10bの各伸長先端側には支持部9aが共通に接 続され、また、上記連結梁10c,10dの各伸長先端側には支持部9bが共通 に接続されている。

#### [0025]

上記各支持部9a, 9bは共に内枠11に連通接続されている。この内枠11 の内側には上記櫛歯形状の検出用可動電極部12(12a, 12b, 12c, 1 2 d) が内枠11に連結して設けられている。また、上記内枠11の内側には上記各検出用可動電極部12に互いに間隔を介して噛み合う櫛歯形状の検出用固定電極部16(16a, 16b, 16c, 16d) がガラス基板4に固定形成された固定部17に設けられている。

#### [0026]

上記のような角速度センサ2では、例えば、上記互いに対向している駆動用固定電極部15と駆動用可動電極部8間に交流の駆動電圧(駆動信号)が印加されると、その駆動電圧に基づいた静電力の大きさの変化によって、固定部13a,13bを支点にして平面振動体5全体が上記各駆動梁6の弾性を利用して図1に示すY方向に駆動振動する。

## [0027]

このように平面振動体 5 全体が Y 方向に駆動している状態で、 Z 方向(図1では紙面に垂直な方向)を中心軸にして回転すると、上記平面振動体 5 の駆動方向(Y 方向)と回転の中心軸方向(Z 方向)に共に直交する方向、つまり、 X 方向にコリオリカが発生する。この X 方向のコリオリカによって、上記平面振動体 5 の内枠 7 が上記支持部 9 a , 9 b を支点とし上記各連結梁 1 0 の弾性を利用して上記外枠 7 に対し相対的に X 方向に検出振動する。この内枠 1 1 の振動と同様に、上記検出用可動電極部 1 2 も同様に X 方向に振動する。

#### [0028]

このX方向の検出振動に基づいた上記検出用固定電極部16と検出用可動電極部12間の静電容量の変化を検出することによって、Z軸回りの角速度の大きさを検出することができる。

#### [0029]

前記加速度センサ3は角速度センサ用の可動体20を有しており、この可動体20は前記角速度センサ2の平面振動体5が形成されている基板と同一のシリコン基板45を加工して形成されたものである。図2(a)に示すように、上記ガラス基板4には上記可動体20に対向する領域に凹部4bが形成されており、この凹部4bによって、上記可動体20は浮いた状態と成し、変位可能となっている。

[0030]

上記可動体20は、図1に示すように、重り部21と支持梁22(22a, 22b, 22c, 22d)と櫛歯形状の検出用可動電極部23(23a, 23b)を有して構成されている。

[0031]

すなわち、上記重り部21はその両端部が支持梁22(22a,22b,22c,22d)によって、ガラス基板4に固定されている固定部24(24a,24b,24c,24d)に接続されている。また、上記重り部21の図の左右端縁部には櫛歯形状の検出用可動電極部23(23a,23b)が形成されている。さらに、上記重り部21の図の左右両側を間隔を介して挟み込む形態で固定部25(25a,25b)がガラス基板4に固定形成されている。これら各固定部25にはそれぞれ上記検出用可動電極部23に間隔を介して噛み合う櫛歯形状の検出用固定電極部26(26a,26b)が設けられている。

[0032]

上記のような加速度センサ3では、上記可動体20は図のY方向に変位することが可能なものであり、Y方向の加速度が印加すると、その加速度に起因して上記重り部21が上記Y方向に変位する。この変位によって、上記検出用可動電極部23と検出用固定電極部26間の間隔が変化し、この間隔変化を検出用可動電極部23と検出用固定電極部26間の静電容量変化として検出することで、加速度の大きさ等を検出することができる。

[0033]

図1および図2(a)、(b)に示すように、上記角速度センサ2の平面振動体5および加速度センサ3の可動体20を間隔を介して囲むように、前記シリコン基板45によってシール部28が設けられ、このシール部28はガラス基板4に陽極接合されている。また、図2(a)に示すように、上記角速度センサ2の平面振動体5および加速度センサ3の可動体20の上側にはガラス基板30が配置されており、該ガラス基板30は上記シール部28に陽極接合されている。前記ガラス基板4とシリコン基板45の陽極接合、および、ガラス基板30とシリコン基板45の陽極接合によって、上記角速度センサ2の平面振動体5等や加速

度センサ3の可動体20等が収容される空間部(センサ収容空間部)32が形成されている。

## [0034]

上記ガラス基板30にも前記ガラス基板4と同様に、角速度センサ2の平面振動体5に対向する領域と、加速度センサ3の可動体20に対向する領域とに凹部30a,30bがそれぞれ形成されている。このため、上記角速度センサ2の平面振動体5および加速度センサ3の可動体20は可動可能な状態で上記センサ収容空間部32内に収容配置されている。

#### [0035]

この実施形態例において最も特徴的なことは、上記センサ収容空間部32が角速度センサ用の空間部33と、加速度センサ用の空間部34とに区分壁部36によって区分され、それら角速度センサ用空間部33と加速度センサ用空間部34はそれぞれ異なった状態で気密封止されていることである。

### [0036]

ところで、上記角速度センサ2においては、前記した如く、角速度を感度良く 検出するためには、平面振動体5を例えば数 k Hz程度の高周波数で、かつ、角速 度検知に必要な設定以上の例えば数 μ m程度の大きな振幅でもって振動させる必 要がある。大気圧雰囲気中では上記平面振動体5を上記のような高周波数、かつ 、大きな振幅で振動させることができないことから、上記平面振動体5を例えば 200Pa程度の真空空間内に配置しなければならない。

#### [0037]

一方、加速度センサ3においては、可動体20は100Hz以下の低周波数で振動することができればよく、その可動体20は大気圧の雰囲気中にあってもよいものである。本発明者は、この点に着目した。そして、加速度センサ3の可動体20を大気圧の雰囲気中に配設すれば、角速度センサ2の平面振動体5側から加速度センサ3の可動体20側へ上記角速度センサ2の平面振動体5の高周波数の振動が伝搬されても、上記加速度センサ3の可動体20は大気圧(空気のダンピング)によって上記高周波数、かつ、大きな振幅でもって振動することはできないということに本発明者は気付いた。

[0038]

このことから、本発明者は前記したような特有な構成、つまり、前記センサ収容空間部32を上記角速度センサ用空間部33と加速度センサ用空間部34に区分壁部36によって区分し、角速度センサ2の平面振動体5を上記角速度センサ用空間部33に、加速度センサ3の可動体20を加速度センサ用空間部34にそれぞれ別個独立に収容配置して、上記角速度センサ2の平面振動体5と加速度センサ3の可動体20をそれぞれ異なる雰囲気中に配置する構成を考え出した。

[0039]

つまり、この実施形態例では、上記角速度センサ用空間部33は平面振動体5を数kHz程度の高周波数、かつ、数μm程度の大きな振幅でもって振動させることが可能な真空状態で気密封止されており、加速度センサ用空間部34は大気圧の空気雰囲気で気密封止されている。

[0040]

これにより、角速度センサ2の平面振動体5は、真空状態によって、高周波数、かつ、大きな振幅でもって振動することができ、角速度センサ2は感度良く角速度を検出することが可能となる。また、その平面振動体5の高周波数の振動が加速度センサ3側に伝搬されても、加速度センサ用空間部34の大気圧によって、上記加速度センサ3の可動体20は高周波数、かつ、大きな振幅でもって振動することはできないので、可動体20の高周波振動を抑制することができる。このため、前記高周波振動に起因したノイズを削減することができて、加速度検出の感度を高めることができる。

[0041]

なお、上記角速度センサ2の平面振動体5および加速度センサ3の可動体20は、それぞれ、設定の定電位(例えばグランド電位)に維持される定電位部位と成している。上記平面振動体5と可動体20は、図1に示すように、シリコン基板45により構成される固定部13と区分壁部36と固定部24とシール部28を介して導通接続されている。

[0042]

例えば、上記ガラス基板30には表面側から、上記固定部13と区分壁部36

と固定部24とシール部28のうちの何れか1つに至るスルーホール(図示せず)が形成されている。このスルーホールの内周面および底面には金属膜が形成されており、該金属膜および上記固定部13と区分壁部36と固定部24とシール部28を介して上記平面振動体5と可動体20は外部の回路に接続して、つまり、グランドに接地することができる。換言すれば、上記スルーホールの金属膜が接触接続する固定部13又は区分壁部36又は固定部24又はシール部28は、上記平面振動体5と可動体20を外部の回路に導通接続するための共通の接続用電極部として機能する。

#### [0043]

また、この実施形態例では、図2(b)に示すように、ガラス基板30には表面側から前記角速度センサ2の固定部14,17、加速度センサ3の固定部25に至るスルーホール38が形成されており、このスルーホール38の内周面および底面には金属膜40が形成されている。該金属膜40と上記各固定部14,17,25を介して角速度センサ2の駆動用固定電極部15、検出用固定電極部16、加速度センサ3の検出用固定電極部26は外部の回路に導通接続可能となっている。これにより、上記センサ収容空間部32内に設けられている駆動用固定電極部15に外部の駆動用回路(図示せず)から平面振動体5を駆動振動させるための電圧を印加したり、検出用固定電極部16と検出用可動電極部12間の静電容量に応じた電圧を外部の信号処理回路(図示せず)に出力したり、検出用固定電極部26と検出用可動電極部23間の静電容量に応じた電圧を外部の信号処理回路(図示せず)に出力することができる。

#### [0044]

さらに、この実施形態例では、図2(b)に示すように、ガラス基板30には 固定部25との間に隙間を形成するための溝41が形成されており、この溝部4 1と、この溝部41に連通する前記スルーホール38Aとによって、前記加速度 センサ用空間部34と外部を連通接続する供給用通路42が構成されている。こ の供給用通路42のスルーホール38Aには封止用部材(例えば樹脂や半田)4 3が形成されて該供給用通路42が塞がれており、これにより、上記加速度セン サ用空間部34は気密封止されている。 [0045]

以下に、本発明に係る複合センサ素子の製造方法の一実施形態例を上記図1、図2に示される複合センサ素子1を例にして図3に基づき説明する。なお、図3では、前記図1に示すA-A部分と、B-B部分に対応する部分の断面が示されている。

[0046]

例えば、まず、図3(a)に示すように、基台であるガラス基板4を加工して前記角速度センサ2の平面振動体5に対向するガラス基板領域と、加速度センサ3の可動体20に対向するガラス基板領域とに凹部4a,4bを例えばエッチング技術等によって形成する。そして、図3(b)に示すように、その凹部4a,4bが形成されたガラス基板4の上側に変位部形成部材であるシリコン基板45を陽極接合する。

[0047]

次に、図3(c)に示すように、フォトリソグラフィーやエッチング等の技術を用いて、上記シリコン基板45を図1に示すようなパターン形状に加工する。これにより、角速度センサ2の平面振動体5と加速度センサ3の可動体20は同時にガラス基板4に対して浮いた状態(つまり、ガラス基板と間隔を介して可動可能な状態)に形成される。

[0048]

然る後に、前記平面振動体 5 が高周波数、かつ、設定以上の大きな振幅(例えば、数μm程度の振幅)で振動することが可能な真空度の真空空間内で、図3(d)に示すように、上記平面振動体 5 および可動体 2 0 が形成されたシリコン基板 4 5 の上側に蓋部材であるガラス基板 3 0 を陽極接合する。このガラス基板 3 0 には、上記陽極接合の前に、上記平面振動体 5 に対向する領域と可動体 2 0 に対向する領域とにそれぞれ凹部 3 0 a, 3 0 b が予め前記ガラス基板 4 の凹部 4 a, 4 b の形成手法と同様の手法により形成されている。このため、上記のように、ガラス基板 3 0 を上記シリコン基板 4 5 の上側に陽極接合することによって、前記平面振動体 5 を振動可能に収容した角速度センサ用空間部 3 3 と、上記可動体 2 0 を振動可能に収容した加速度センサ用空間部 3 4 とが形成される。また

、それと同時に、上記平面振動体 5 を収容した角速度センサ用空間部 3 3 が上記 真空状態に気密封止される。

### [0049]

さらに、上記陽極接合の前に、上記ガラス基板30には前記スルーホール38 や溝部41が予め形成されており、上記ガラス基板30とシリコン基板45の陽 極接合時に、スルーホール38Aと上記溝41によって供給用通路42が形成される。

#### [0050]

その後に、図3 (e)に示すように、上記スルーホール38の内周面および底面にスパッタリング等の成膜形成技術を利用して金属膜40を形成する。

#### [0051]

そして、然る後に、上記ガラス基板4,30とシリコン基板45の接合体を上記真空空間から大気中に取り出す。これにより、上記供給用通路42から上記加速度センサ用空間部34に空気が入り込み、該加速度センサ用空間部34は大気圧と成す。このように、加速度センサ用空間部34が大気圧と成した以降に、上記スルーホール38Aを例えば樹脂や半田等の封止用部材43によって封止する。これにより、供給用通路42が塞がって上記加速度センサ用空間部34は大気圧(つまり、可動体20が100Hz以下の低周波数で振動可能で、かつ、平面振動体5の振動が上記可動体20に伝搬しても該可動体20が高周波数、かつ、大きな振幅でもって振動することを防止できる気圧状態)に気密封止される。

#### [0052]

なお、この実施形態例では、前記封止用部材43は溶融状態で粘性が大きいものを使用しており、かつ、前記供給用通路42の溝41部分はその通路断面積が非常に狭くなっている。このため、上記スルーホール38Aを封止するために上記スルーホール38A内の封止用部材43を溶融した際(あるいは、溶融状態の封止用部材43を上記スルーホール38A内に配置させた際)に、その溶融状態の封止用部材43が上記溝41を通って上記加速度センサ用空間部34に入り込む事態発生を回避している。

[0053]

以上のようにして、この実施形態例に示す複合センサ素子1を製造することができる。

# [0054]

この実施形態例によれば、角速度センサ2の平面振動体5が収容配置されている角速度センサ用空間部33は上記平面振動体5が高周波数、かつ、設定以上の大きな振幅でもって振動することができる真空状態で気密封止されている。また、加速度センサ3の可動体20が収容配置されている加速度センサ用空間部34は大気圧状態で気密封止されている。このような構成のため、上記平面振動体5は高周波数、かつ、大きな振幅でもって振動することができ、角速度を感度良く検出することが可能である上に、その平面振動体5の高周波数の振動が加速度センサ3側に伝搬しても、加速度センサ3の可動体20は、大気圧によって、上記のような高周波数、かつ、大きな振幅でもって振動することはできず、高周波振動に起因したノイズを抑制することができて、感度良く加速度を検出することができる。

#### [0055]

また、この実施形態例では、定電位部位である平面振動体 5 と可動体 2 0 を外部の回路に接続するための共通の接続用電極部を設けたので、平面振動体 5 用の接続用電極部と、可動体 2 0 用の接続用電極部とをそれぞれ別個に設ける場合に比べて、複合センサ素子 1 の小型化を図ることができるし、複合センサ素子 1 と外部の回路とを導通接続させるための配線作業の手間を軽減することができる。

#### [0056]

さらに、この実施形態例では、複合センサ素子1の製造工程において、同一のシリコン基板45を利用して上記角速度センサ2の平面振動体5と加速度センサ3の可動体20を同時に形成するので、角速度センサ2の平面振動体5と加速度センサ3の可動体20を組み合わせる工程が不要であり、製造工程の簡略化を図ることが可能となり、かつ、角速度センサ2と加速度センサ3の検出軸ずれを防止することができる。

# [0057]

なお、この発明は上記実施形態例に限定されるものではなく、様々な実施の形

態を採り得る。例えば、上記実施形態例では、加速度センサ用空間部34は大気圧の雰囲気で気密封止されていたが、例えば、加速度センサ3の可動体20が100Hz以下の低周波数で振動することができ、かつ、角速度センサ2の平面振動体5の振動が伝搬されても上記可動体20が高周波数、かつ、設定以上の大きな振幅でもって振動するのを抑制することができる気圧状態であればよく、大気圧に限定されるものではない。また、上記実施形態例では、加速度センサ用空間部34は空気による大気圧状態で気密封止されていたが、例えば、空気に代えて、不活性ガスの雰囲気で気密封止してもよい。

#### [0058]

さらに、大気圧の雰囲気に代えて、例えば、シリコンオイル等のダンピング剤 を加速度センサ用空間部34に充填して気密封止してもよい。

## [0059]

さらに、上記実施形態例では、基台としてガラス基板4を用いたが、ガラス基板4に代えて、シリコン基板等の他の材料の基板を基台として用いてもよい。さらに、上記実施形態例では、蓋部材としてガラス基板30を利用したが、シリコン等の他の材料の部材を蓋部材として利用してもよい。

#### [0060]

さらに、上記実施形態例では、角速度センサ2の平面振動体5と、加速度センサ3の可動体20とはグランド電位に維持されていたが、それら平面振動体5と可動体20は設定の定電位に維持されていればよく、グランド電位以外の定電位に維持されていてもよい。

#### [0061]

さらに、上記実施形態例では、ガラス基板30に形成されたスルーホール38 Aはその内周面と底面に形成された金属膜40によって外部と固定部25を導通 接続させるための機能と、前記供給用通路42を構成する機能とを兼用するもの であったが、上記固定部25を外部に導通接続させるためのスルーホールと、上 記供給用通路42を構成するためのスルーホールとを別個に設けてもよい。上記 供給用通路42を構成する専用のスルーホールを設ける場合に、そのスルーホールを樹脂の封止用部材によって塞ぐ場合には、スルーホールの内周面に金属膜を 形成しなくともよい。なお、半田の封止用部材を用いる場合には、下地膜として 金属膜をスルーホールの内周面に形成する。

[0062]

さらに、上記実施形態例では、真空室内で、上記基台であるガラス基板4の上側に接合されたシリコン基板(変位部形成部材)45と、蓋部材であるガラス基板30とを陽極接合することによって、角速度センサ用空間部33を真空状態に気密封止する構成であったが、例えば、応用例として、上記角速度センサ用空間部33と外部を連通するガス抜き通路を形成し、前記陽極接合した後に、そのガス抜き通路を介して角速度センサ用空間部33を真空排気し、角速度センサ用空間部33が所望の真空状態となった以降に、上記ガス抜き通路を塞いで角速度センサ用空間部33を真空状態に気密封止してもよい。

[0063]

さらに、上記実施形態例では、角速度センサ2の平面振動体5と、加速度センサ3の可動体20との下方側にそれぞれ対向するガラス基板領域に凹部4a,4bを形成することで、上記平面振動体5と可動体20をガラス基板4に対して浮いた状態に形成していたが、例えば、図4(a)、(e)に示すように、上記平面振動体5を形成するシリコン基板領域45aと可動体20を形成するシリコン基板領域45bを他の部位よりも薄く形成することで、ガラス基板4に対して浮いた状態としてもよい。

[0064]

図4 (e) に示すような複合センサ素子1は次に示すように作製することができる。なお、以下に説明する複合センサ素子1の製造工程において、その複合センサ素子1の角速度センサ2は図1と同様のパターン形状を持つ平面振動体5を有し、かつ、加速度センサ3は図1と同様のパターン形状を持つ可動体20を有している。また、図4では、図1に示すA-A部分と、B-B部分に対応する部分の断面が示されている。

[0065]

例えば、図4 (a) に示すように、変位部形成部材であるシリコン基板45の 上記平面振動体5を形成する領域45aと、上記可動体20を形成する領域45 bとを表裏両面側から例えばエッチング技術等を利用して薄くする。そして、図4 (b) に示すように、その加工されたシリコン基板45の下方側に基台であるガラス基板4を陽極接合する。

[0066]

次に、図4(c)に示すように、フォトリソグラフィーやエッチング等の技術を利用して上記シリコン基板45における前記肉薄の領域45a,45bを加工して図1に示すようなパターン形状に加工する。これにより、上記ガラス基板4に対して浮いた状態の前記角速度センサ2の平面振動体5および加速度センサ3の可動体20が形作られる。

[0067]

そして、図4(d)に示すように、その平面振動体5や可動体20が形成されたシリコン基板45の上方側に蓋部材であるガラス基板30を陽極接合する。このガラス基板30には、上記陽極接合の前に、予め、供給用通路42を形成するための溝部41や、スルーホール38が形成されている。上記実施形態例と同様に、上記ガラス基板30をシリコン基板45上に陽極接合することによって、角速度センサ用空間部33と加速度センサ用空間部34が形成されると同時に、その角速度センサ用空間部33に角速度センサ2の平面振動体5が振動可能な状態で収容封止され、かつ、上記加速度センサ用空間部34に加速度センサ3の可動体20が変位可能な状態で収容される。

[0068]

なお、この陽極接合の際には、上記実施形態例と同様に、上記平面振動体 5 が 高周波数、かつ、設定以上の大きな振幅で振動することが可能な真空度の真空室 内で、上記ガラス基板 3 0 とシリコン基板 4 5 の陽極接合が行われ、これにより 、上記角速度センサ用空間部 3 3 は、上記実施形態例と同様に、平面振動体 5 が 高周波数、かつ、設定以上の大きな振幅で振動することが可能な真空状態に気密 封止される。

[0069]

上記のように、ガラス基板30とシリコン基板45の陽極接合が成された以降 には、上記実施形態例と同様に、スルーホール38に金属膜40を形成し、また 、上記ガラス基板4とシリコン基板45とガラス基板30の接合体を大気圧中に 配置して上記加速度センサ用空間部34を上記供給用通路42を介して大気圧状態にする。その後に、上記封止用部材43で供給用通路42を塞いで、上記加速 度センサ用空間部34を大気圧状態に気密封止する。

[0070]

上記のようにして、図4 (e) に示すような複合センサ素子1を製造することができる。

[0071]

さらに、上記実施形態例では、基台としてガラス基板4を利用し、かつ、変位 部形成部材としてシリコン基板45を利用していたが、例えば、図5(a)に示 すような支持層(シリコン層)47と酸化層(酸化シリコン層)48と活性層( シリコン層)49が積層形成されて成るSOI(Silicon On Insulator)基板5 0を用いて、例えば、上記SOI基板50の支持層47と酸化層48を基台とし て、上記活性層49を変位部形成部材として利用してもよい。

[0072]

このようなSOI基板50を利用した複合センサ素子1は次に示すように作製することができる。なお、上記SOI基板50を利用した複合センサ素子1の製造工程の説明において、その複合センサ素子1の角速度センサ2は図1と同様のパターン形状を持つ平面振動体5を有し、かつ、加速度センサ3は図1と同様のパターン形状を持つ可動体20を有しているとし、図5では、図1に示すA-A部分とB-B部分に対応する部分の断面が示されている。

[0073]

例えば、まず、図5(a)に示すように、SOI基板50を用意し、次に、図5(b)に示すように、そのSOI基板50の活性層49をエッチング等の技術を利用して、図1に示すようなパターン形状に加工する。これにより、角速度センサ2の平面振動体5と加速度センサ3の可動体20が形作られる。

[0074]

その後、図5 (c)に示すように、上記平面振動体5と可動体20の下方側となる部位の酸化層48を犠牲層エッチング等によって部分的に除去する。これに

より、上記平面振動体 5 と可動体 2 0 は支持層 4 7 (基台) に対して浮いた状態となる。

### [0075]

然る後に、図5 (d)に示すように、上記平面振動体5や可動体20が形成された活性層49の上側に蓋部材であるガラス基板30を陽極接合する。このガラス基板30には、上記実施形態例と同様に、陽極接合の前に予め、上記平面振動体5に対向する領域と、可動体20に対向する領域とにそれぞれ凹部30a,30bが形成され、また、スルーホール38や溝部41が形成されている。上記凹部30a,30があるために、上記実施形態例と同様に、上記活性層49とガラス基板30の陽極接合を行うことによって、角速度センサ用空間部33と加速度センサ用空間部34が形成されると同時に、その角速度センサ用空間部33、上記加速度センサ用空間部34にそれぞれ角速度センサ2の平面振動体5、加速度センサ3の可動体20が変位可能な状態で収容される。

# [0076]

この陽極接合の際にも、上記実施形態例と同様に、上記平面振動体 5 が高周波数、かつ、設定以上の大きな振幅で振動することが可能な真空度の真空室内で、上記ガラス基板 3 0 と活性層 4 9 の陽極接合が行われ、これにより、上記角速度センサ用空間部 3 3 は、平面振動体 5 が高周波数、かつ、設定以上の大きな振幅で振動することが可能な真空状態に気密封止される。

#### [0077]

そして、上記陽極接合の後には、上記実施形態例と同様に、スルーホール38 に金属膜40を形成し、また、上記SOI基板50とガラス基板30の接合体を 大気圧中に配置して上記加速度センサ用空間部34を上記供給用通路42を介し て大気圧状態にする。その後に、図5(e)に示すように、上記封止用部材43 で供給用通路42を塞いで、上記加速度センサ用空間部34を大気圧状態に気密 封止する。以上のようにして、SOI基板50を利用した複合センサ素子1を製 造することができる。

# [0078]

さらに、上記実施形態例では、角速度センサ2の平面振動体5や、加速度セン

サ用の可動体 2 0 は、図 1 に示すような形状と成していたが、上記角速度センサ 用の振動体、加速度センサ用の可動体の各形状は、図 1 に示す形態に限定される ものではなく、様々な形態を採り得る。

[0079]

## 【発明の効果】

この発明の複合センサ素子によれば、基台上に配設された同一の変位部形成部材によって角速度センサ用の振動体と加速度センサ用の可動体を形成するが、上記角速度センサ用の振動体と加速度センサ用の可動体とをそれぞれ異なる空間部に収容配置する構成とし、上記角速度センサ用の振動体がkHzオーダー以上の高周波数、かつ、設定以上の大きな振幅でもって振動することが可能な真空状態内に上記角速度センサ用の振動体を配置すると共に、加速度センサ用の可動体を高周波振動抑制用(つまり、上記加速度センサ用の可動体が100Hz以下の低周波数で振動することができ、かつ、角速度センサ用の振動体の振動が上記加速度センサ用の可動体に伝搬しても該可動体が高周波数、かつ、設定以上の大きな振幅でもって振動することを防止するため用)の気圧状態、あるいは、高周波振動抑制用のダンピング剤が充填されている状態内に配置する。

[0080]

これにより、角速度センサ用の振動体は上記真空状態によって良好に高周波数で振動することができ、感度良く角速度を検出することができる。また、その角速度センサ用の振動体の高周波数の振動が加速度センサ側に伝搬されても、高周波振動抑制用の気圧状態あるいはダンピング剤によって、加速度センサ用の可動体が高周波数、かつ、大きな振幅でもって振動することを抑制することができるので、加速度センサ用の可動体の高周波数振動に起因した感度悪化問題を防止することができ、加速度に関しても感度良く検出することができる。このように、角速度の検出感度と加速度の検出感度が共に優れた複合センサ素子を提供することが可能となる。

[0081]

また、加速度センサの可動体は、高周波振動抑制用の気圧状態、あるいは、高周波振動抑制用のダンピング剤中に配置されているので、該可動体の共振周波数

成分を持つ加速度が印加されたときに、当該可動体が共振状態となることを回避することができ、この可動体は上記印加された加速度の大きさに応じて可動することができる。これにより、可動体の共振周波数成分を持つ加速度に関しても、正確に検出することができることとなり、加速度検知の信頼性を向上させることができる。

[0082]

基台が、SOI基板の支持層と酸化層により構成され、変位部形成部材はSOI基板の活性層により形成されているものにあっては、予め基台と変位部形成部材とが接合されている状態と成しているので、複合センサ素子の製造工程中に、基台と変位部形成部材とを接合するという工程を設けなくて済み、製造工程の簡略化を図ることができる。

[0083]

角速度センサの定電位部位と加速度センサの定電位部位とに共通の接続用電極部が設けられているものにあっては、角速度センサの定電位部位に専用の接続用電極部と加速度センサの定電位部位に専用の接続用電極部とを別個に設ける場合に比べて、複合センサ素子の小型化を図ることができる。

[0084]

この発明の複合センサ素子の製造方法によれば、角速度センサ用の振動体と加速度センサ用の可動体とを同時に形成するので、製造工程の簡略化を図ることができ、また、角速度センサと加速度センサの検出軸ずれを防止することができる。 さらに、この発明における製造方法を用いることによって、角速度センサ用空間部と加速度センサ用空間部とをそれぞれ異なる状態で気密封止することができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る複合センサ素子の一実施形態例を模式的に示す平面図である。

【図2】

図1に示す複合センサ素子のA-A部分、B-B部分の断面図を模式的に示す 説明図である。



図1に示す複合センサ素子の製造方法の一実施形態例を示す説明図である。

# 【図4】

複合センサ素子のその他の実施形態例およびその製造方法の一例を示す説明図である。

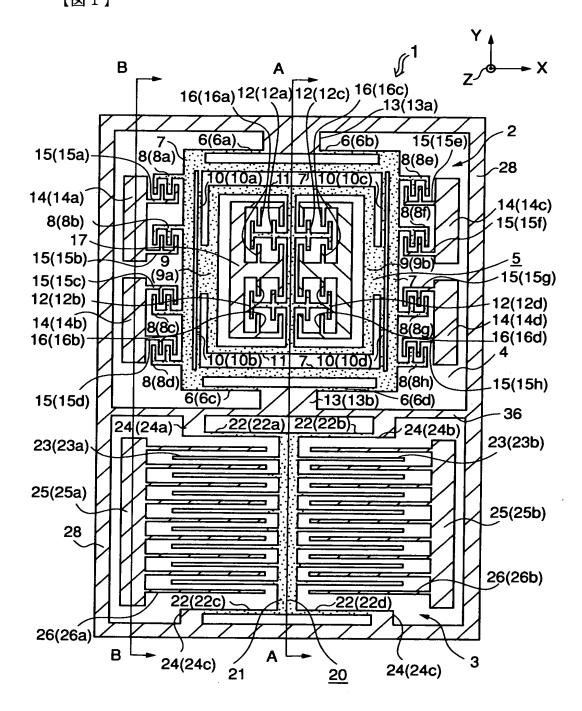
# 【図5】

さらに、複合センサ素子のその他の実施形態例およびその製造方法の一例を示す説明図である。

# 【符号の説明】

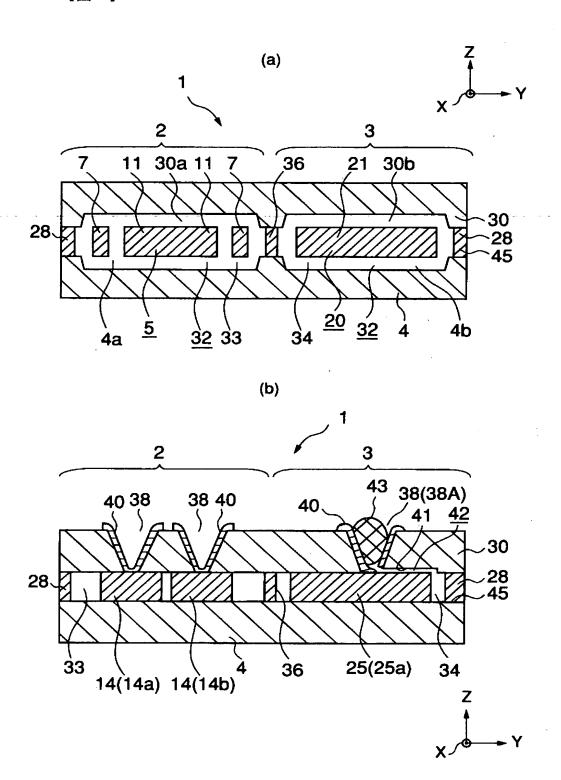
- 1 複合センサ素子
  - 2 角速度センサ
  - 3 加速度センサ
  - 4,30 ガラス基板
  - 5 平面振動体
  - 20 可動体
  - 32 センサ収容空間部
  - 33 角速度センサ用空間部
  - 34 加速度センサ用空間部
  - 36 区分壁部
  - 38 スルーホール
  - 42 供給用通路
  - 43 封止用部材
  - 50 SOI基板

【書類名】 図面【図1】

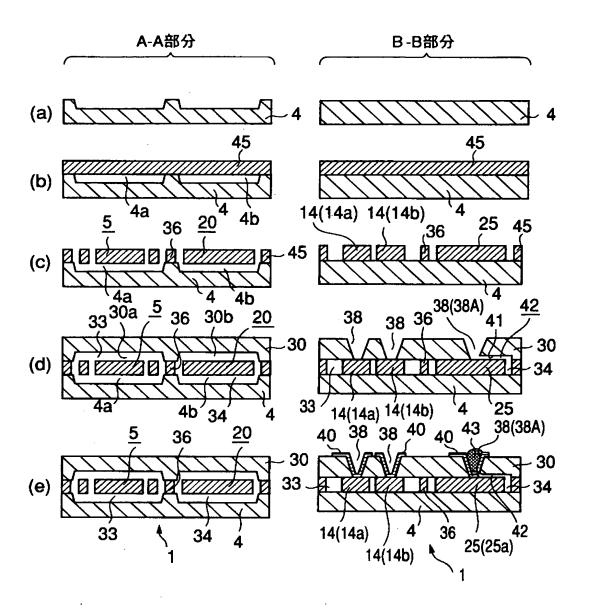


1

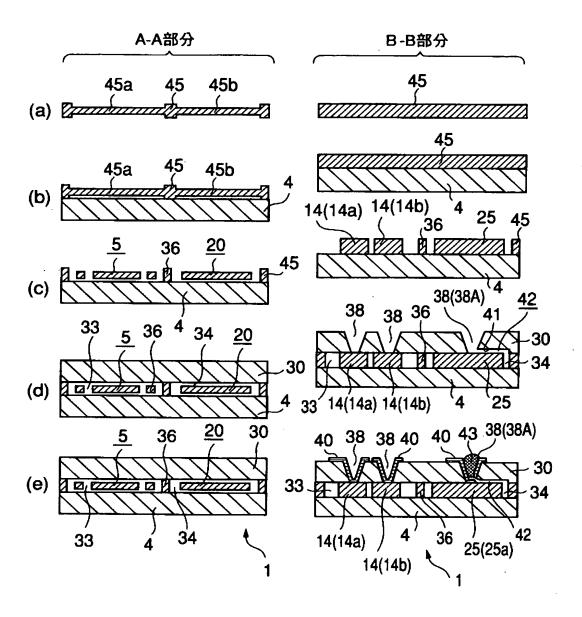
【図2】



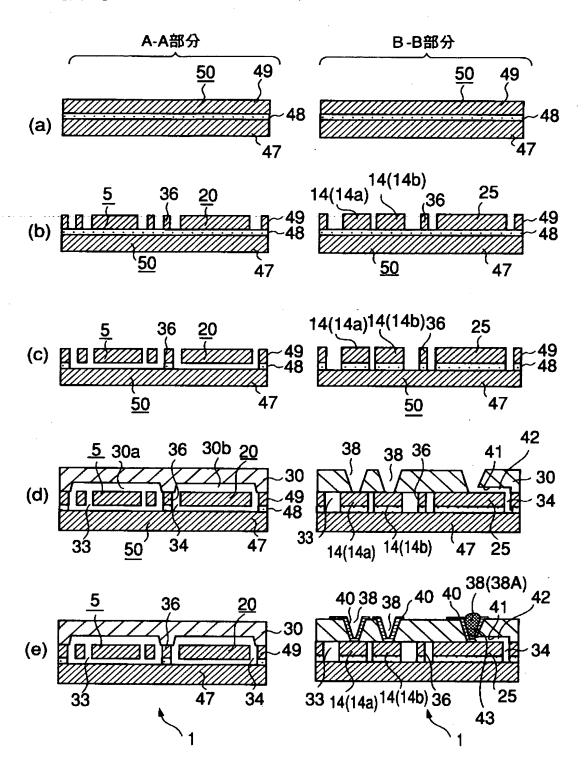
【図3】



【図4】



【図5】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 角速度センサと加速度センサの両方共に検出感度に優れた複合センサ素子を提供する。

【解決手段】 角速度センサ2の平面振動体5と、加速度センサ3の可動体20とを同一の基板4上に互いに間隔を介して浮いた状態に設ける。平面振動体5と可動体20の上側を間隔を介して覆う蓋部材30を形成する。基板4と蓋部材30から成る空間部32を区分壁部36によって角速度センサ用空間部33と加速度センサ用空間部34に区分する。角速度センサ用空間部33は真空状態で気密封止された状態と成し、加速度センサ用空間部34は大気圧で気密封止された状態と成している。平面振動体5は高周波数・大きな振幅で振動して角速度検知感度を高め、可動体20はその平面振動体5の振動が伝搬されても空気のダンピングによって高周波数・大きな振幅で振動せず、加速度検知感度を高める。

【選択図】

図 2

# 出願人履歴情報

識別番号

[000006231]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名

株式会社村田製作所